

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 13 日 (13.10.2005)

PCT

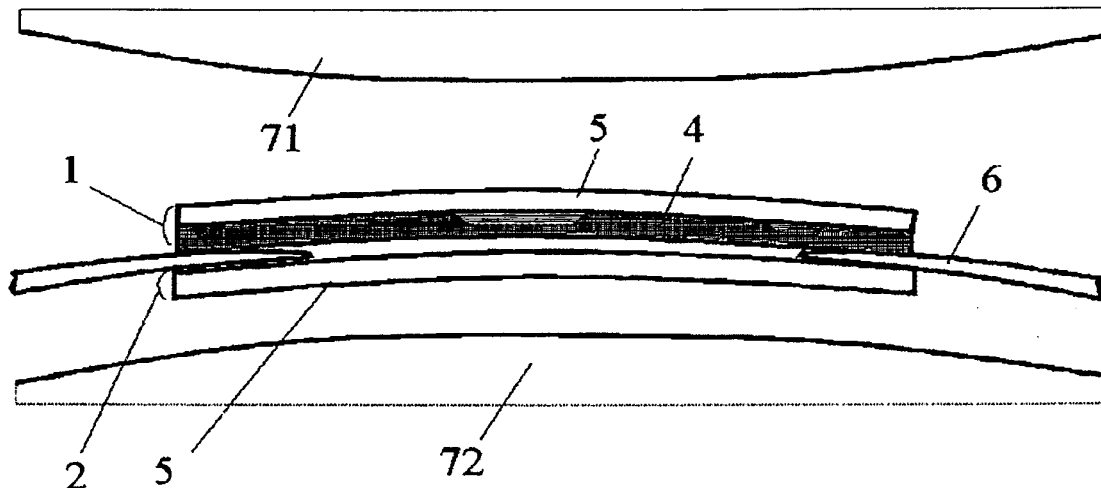
(10) 国際公開番号
WO 2005/094915 A1

- (51) 国際特許分類⁷: A61L 31/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006369 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 守永 幸弘 (MORI-NAGA, Yukihiro) [JP/JP]; 〒5318510 大阪府大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号ニプロ株式会社内 Osaka (JP). 神村 亮介 (KAMIMURA, Ryosuke) [JP/JP]; 〒5318510 大阪府大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号ニプロ株式会社内 Osaka (JP). 松田 和久 (MATSUDA, Kazuhisa) [JP/JP]; 〒5318510 大阪府大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号ニプロ株式会社内 Osaka (JP). 白敷 昭雄 (SHIRASU, Akio) [JP/JP]; 〒5318510 大阪府大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号ニプロ株式会社内 Osaka (JP).
(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 31 日 (31.03.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2004-102638 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004) JP
特願2004-264902 2004 年 9 月 13 日 (13.09.2004) JP
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ニプロ株式会社 (NIPRO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5318510 大阪府大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号 Osaka (JP).
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: ANTIADHESIVE KIT, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME AND METHOD OF ADHESION PREVENTION

(54) 発明の名称: 癒着防止用キット、癒着防止用キットの製造方法および癒着防止方法



(57) Abstract: An antiadhesive kit that even around damaged or fractured tissue end portions, exerts an adhesion preventing effect; and a relevant method of adhesion prevention. There is provided an antiadhesive kit capable of preventing adhesion during guided regeneration therapy for damaged tissue, in particular, an antiadhesive kit comprising a first film of at least two layers having a biodegradable base layer and an antiadhesive layer disposed at outermost surfaces thereof and a second film of at least one layer having an antiadhesive layer disposed at an outermost surface thereof (A), or comprising an antiadhesive film including a biodegradable base layer and an antiadhesive layer, which film has an outermost surface constituted of the antiadhesive layer and is fitted with a tissue tight holding part (B).

(57) 要約: 損傷または欠損した組織端部周辺においても、癒着を防止する効果を有する癒着防止用キットおよび癒着防止方法の開発が求められている。本発明は、損傷した組織の誘導再生治療時における癒着を防止する癒着防止用キットに関する。具体的には、(A)生分解性基材層および癒着防止層をそれぞれ最外面に設けた少なくとも 2 層の第 1 の膜と、最外面に癒着防止層を設けた少なくとも 1 層の第 2 の膜、

[続葉有]



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。